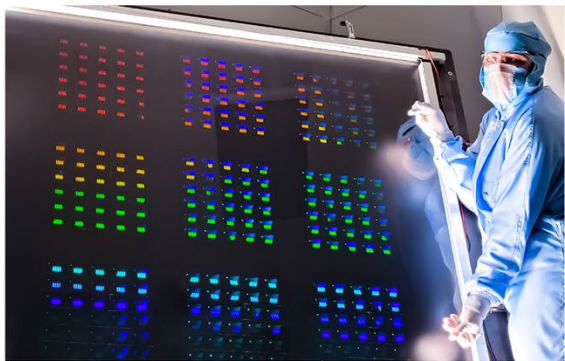


Portis 1100 平台

极致模块化的全能灵活智造平台



Portis 1100是一款面向工业制造场景的卷对板（R2P）纳米压印平台，集研发、工艺验证与量产功能于一体，凭借大尺寸加工能力、模块化架构与全拓展式设计，可轻松适配多元化应用场景。



参数	规格
基板尺寸	最大支持5代线（1100×1300mm ² ）
基板厚度	0.5 - 10mm
基板材料	刚性与柔性材料（玻璃、聚合物、金属）
可加工结构尺寸	50nm至500μm
节拍时间	最快<5 分钟
粘度范围	搭配 C1100 涂布机，支持 5-1500mPas 粘度范围
喷涂工艺	搭配 P1100 底涂机，实现可编程精准喷涂

大规模高品质压印

Portis 1100可实现超薄残留层成型，支持高粘度材料无气泡压印，具备优异的横向尺寸稳定性，全面兼容各类预处理与后处理工艺。一套可扩展平台，同时满足研发实验与量产级产能需求。

稳定可扩展·高可靠工业级设计

平台各模块全自动运行，确保结果稳定可复现；基板上下料与模块移位采用手动操控，按需实现精准交互。独立灵活架构支持快速重构，可随生产需求灵活新增、升级或调整模块，长期适配业务迭代。



更多精彩内容
请关注魔飞光电公众号

morphotonics.com

info@morphotonics.com

+86 138 1699 3192



MORPHOTONICS